(19) 日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号

特許第5349739号 (P5349739)

(45) 発行日 平成25年11月20日(2013.11.20)

- (24) 登録日 平成25年8月30日 (2013.8.30)
- (51) Int. CL. FΤ GO 1 B 9/02 (2006.01) GO1B 9/02 GO1B 11/24 (2006.01) GO1B 11/24 D

(全 17 頁) 請求項の数4

(21) 出願番号	特願2006-114308 (P2006-114308)	(73)特許権者	f 000137694 株式会社を楽しつ
(22) 出願口 (65) 公開番号	平成18年4月18日 (2006.4.18) 特開2006-329975 (P2006-329975A)		林式会在ミットコ神奈川県川崎市高津区坂戸一丁目20番1
(43) 公開日	平成18年12月7日 (2006.12.7)		명
審査請求日	平成21年2月25日 (2009.2.25)	(74)代理人	100092820
番判番ぢ 案判議並日	个版2012-7830(P2012-7830/J1) 亚成24年4月27日 (2012-4-27)	(79) 発明者	开理工 伊丹 <i>閼</i> 川▼崎▲ 和彦
(31) 優先権主張番号	+成24年4月21日(2012.4.21) 特願2005-128872 (P2005-128872)	(12) 76471	「↓ ● ● 「 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
(32)優先日	平成17年4月27日 (2005.4.27)		式会社ミツトヨ内
(33)優先権主張国	日本国(JP)	(72)発明者	鈴木 義将
			茨城県つくば市上横場430番地の1 株
			式会社ミツトヨ内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】干渉計及び干渉計の校正方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

出射される出射光の波長を変更可能に構成された波長可変光源と、

該出射光を測定光と参照光とに分割すると共に、参照面で反射した前記参照光及び測定 対象物で反射した前記測定光を合成して合成光とする光分割合成部材と、

前記合成光を複数の分割光に分割する光分割手段と、

前記複数の分割光の各々の間に所定の位相差を与える複数の位相シフト光学部材と、

位相をシフトさせられた前記複数の分割光の各々により形成される複数の干渉縞画像を 撮像する撮像部と、

前記波長可変光源を制御して前記出射光の波長を複数通りに変化させる波長制御部と、 前記測定対象物の一部又は前記測定対象物に代えた校正用基板を設置して前記波長制御 部により前記出射光の波長を複数通りに変化させた場合に前記複数の分割光のそれぞれに より得られる複数通りの干渉縞の画像を各前記撮像部により撮像させ、撮像された複数通 りの干渉縞の干渉縞強度に基づき、前記複数の分割光のそれぞれによる干渉縞の干渉縞強 度のバイアス、振幅及び位相シフト量を演算する演算部と

を備え、

前記波長制御部は、前記出射光の複数通りの波長の各々を、複数通りの基準波長の1つ を基準として、前記撮像部の露光時間内において所定の波長走査幅で変動させる制御を実 行するものであり、

前記撮像部は、前記露光時間内における前記出射光の波長の変動によって得られる干渉

20

縞画像を撮像するように構成された

ことを特徴とする干渉計。

【請求項2】

前記波長走査幅は、前記測定対象物の裏面からの反射光と前記参照光との間の光路差が 可干渉距離よりも大きく、且つ前記測定光と前記参照光との間の光路差が可干渉距離より も小さくなるように設定されることを特徴とする請求項<u>1</u>記載の干渉計。 【請求項3】

光源から出射された出射光を測定光と参照光とに分割し、参照面で反射した前記参照光 及び測定対象物で反射した前記反射光を再び合成して合成光とし、この合成光を複数の分 割光に分割して前記複数の分割光の各々の間に所定の位相差を与えて得られた複数の干渉 縞画像を解析することにより測定対象物の形状を測定する干渉計の校正方法において、

前記測定対象物の一部又は前記測定対象物に代えた校正用基板を設置するステップと、 前記出射光の波長を複数通りに変化させるステップと、

前記出射光の波長の変化に基づいて前記複数の分割光のそれぞれにより得られる複数通 りの干渉縞を撮像するステップと、

その撮像された干渉縞の干渉縞強度を取得して、前記複数の分割光の各々のバイアス、 振幅及び位相シフト量を演算するステップと

を備え、

前記出射光の波長を複数通りに変化させるステップは、<u>前記出射光の複数通りの波長の</u> <u>各々を</u>、複数通りの基準波長<u>の1つ</u>を基準として、撮像のための露光時間内におい<u>て所</u>定 ²⁰ の波長走査幅で変動させ、

前記撮像するステップは、前記露光時間内における前記出射光の波長の変動によって得られる干渉
縞画像を撮像する

ことを特徴とする干渉計の校正方法。

【請求項4】

前記波長走査幅は、前記測定対象物の裏面からの反射光と前記参照光との間の光路差が 可干渉距離よりも大きく、且つ前記測定光と前記参照光との間の光路差が可干渉距離より も小さくなるように設定されることを特徴とする請求項<u>3</u>記載の干渉計の校正方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、干渉計及び干渉計の校正方法に関する。

【背景技術】

【0002】

干渉計により得られた干渉縞の解析方法として、位相シフト法がある。位相シフト法は 、参照面を光軸方向に変位させるなどの手法により、干渉縞の位相をシフトさせて、複数 枚の干渉縞画像を取得し、測定対象物の形状を算出する方法である。高い精度が得られる ため、現在では、多くの干渉計に適用されている。

しかし、この位相シフト法は、参照面を変位させながら干渉縞を取得するため、測定に 40 時間を要する。また、干渉縞を取得する間、測定対象物を静定している必要があるため、 振動などの揺らぎを排除した特別な環境下でしか使用することができなかった。

【0004】

これに対し、複数の撮像素子を用いて、光学的に位相をシフトさせた干渉縞を同時に撮像する方法が、例えば特許文献1、特許文献2により知られている。この文献では、参照 光と物体光とを合成した合成光をビームスプリッタで3つに分割し、この3つの分割光を それぞれ偏光方向の異なる3つの偏光板を通過させて3つの撮像素子に投影する位相シフ ト法を開示している。この方法によれば、位相シフト法で演算処理するのに必要な枚数の 干渉縞画像を瞬時に取り込むことができるため測定の高速化が図れる。また、振動条件下 での測定も可能になる。

(2)

10

[0005]

しかし、この特許文献1、2の方法で測定対象物を高精度に測定するためには、位相シ フトされた3枚の干渉縞画像の対応点のバイアス、振幅が等しいことが前提となる。とこ ろが、ビームスプリッタにおける分割強度誤差や / 4板の進相軸、遅相軸の設置誤差の 影響により、3枚の干渉縞画像間のバイアスと振幅を等しくすることは困難であり、これ が測定精度の低下を招いている。

[0006]

また、3つの偏光板の偏光軸の設置誤差が生じれば、3枚の干渉縞画像間の位相シフト 量が設計値と異なってしまうので、測定対象物面によって発生した干渉縞に対して、測定 原理に即した設計値通りの位相シフト量を得ることはできず、やはり測定精度が低下する

[0007]

測定精度の向上のためには、干渉計を構成する光学部品を高精度に製作すると共に、高 精度な調整機構を利用して干渉計を調整する必要がある。しかし、干渉計筐体の経時変化 や温度変動などによる幾何学的な寸法変化や光学部品の性能の変化などにより、干渉計の 製作直後に値付けされたバイアス値、振幅値、及び位相は変化してしまう。従って、ユー ザが干渉計を使用する環境において、定期的に、あるいは測定の前において、ユーザがこ れらの値を容易に値付けできるようにすることが好ましい。これにより、高速、高精度で 使用環境を選ばない干渉計による測定が実現するからである。

【特許文献1】特開平2-287107号公報

【特許文献2】特開2000-329535号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

本発明は、位相をシフトさせた干渉縞を光学的手法により同時に取得する干渉計におい て、複数の撮像素子から得られる干渉縞の干渉縞強度のバイアス及び振幅のバラツキ、並 びに位相の設計値からの偏差を、定期的に又は測定の前にユーザが容易に計測することを 可能とし、測定の高精度化を達成すると共に、使用環境を選ばない干渉計及び干渉計の校 正方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0009]

上記目的を達成するため、本発明に係る干渉計は、出射される出射光の波長を変更可能 に構成された波長可変光源と、該出射光を測定光と参照光とに分割すると共に、参照面で 反射した前記参照光及び測定対象物で反射した前記測定光を合成して合成光とする光分割 合成部材と、前記合成光を複数の分割光に分割する光分割手段と、前記複数の分割光の各 々の間に所定の位相差を与える複数の位相シフト光学部材と、位相をシフトさせられた前 記複数の分割光の各々により形成される複数の干渉縞画像を撮像する撮像部と、前記波長 可変光源を制御して前記出射光の波長を複数通りに変化させる波長制御部と、<u>前記測定対 象物の一部又は前記測定対象物に代えた校正用基板を治具に固定</u>して前記波長制御部によ り前記出射光の波長を複数通りに変化させた場合に前記複数の分割光のそれぞれにより得 られる複数通りの干渉縞の画像を各前記撮像部により撮像させ、撮像された複数通りの干 渉縞の干渉縞強度に基づき、前記複数の分割光のそれぞれによる干渉縞強度のバ イアス、振幅及び位相シフト量を演算する演算部とを備えたことを特徴とする。 【0010】

上記目的を達成するため、本発明に係る干渉計の校正方法は、光源から出射された出射 光を測定光と参照光とに分割し、参照面で反射した前記参照光及び測定対象物で反射した 前記反射光を再び合成して合成光とし、この合成光を複数の分割光に分割して前記複数の 分割光の各々の間に所定の位相差を与えて得られた複数の干渉縞画像を解析することによ り測定対象物の形状を測定する干渉計の校正方法において、<u>前記測定対象物の一部又は前</u> 記測定対象物に代えた校正用基板を治具に固定するステップと、前記出射光の波長を複数

20

10

通りに変化させるステップと、前記出射光の波長の変化に基づいて前記複数の分割光のそ れぞれにより得られる複数通りの干渉縞を撮像するステップと、その撮像された干渉縞の 干渉縞強度を取得して、前記複数の分割光の各々のバイアス、振幅及び位相シフト量を演 算するステップとを備えたことを特徴とする。

【発明の効果】

[0011]

この発明によれば、複数の干渉縞画像の干渉縞強度のバイアス及び振幅のバラツキ、並 びに位相の設計値からの偏差を、定期的に又は測定の前にユーザが容易に計測することが 可能となり、これにより測定の高精度化が達成されると共に、使用環境を選ばない干渉計 及び干渉計の校正方法を提供することができる。

10

20

30

【発明を実施するための最良の形態】

【0012】

次に、本発明の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。

【0013】

図1は、本発明の第1の実施の形態に係る干渉計の全体構成を示している。この実施の 形態の干渉計は、波長可変レーザ301と、集光レンズ302と、ピンホール303と、 コリメータレンズ304とからなる投光系を備えている。波長可変レーザ301は、出射 光の波長を複数通りに変化させることができるように構成されており、その波長の制御は 、コンピュータ401により、波長コントローラ402を介して行われる。コンピュータ 401は、撮像された干渉縞画像を解析し、測定対象物の形状を演算するためのソフトウ エアをインストールされたものである。また、コンピュータ401は、干渉計の校正動作 の実行時において、波長可変レーザ301の出射光の波長を制御する制御信号を出力する 。波長コントローラ402は、この制御信号に基づき、波長可変レーザ301の波長を制 御する。

【0014】

この投光系から射出された出射光は、光分割合成部材としての偏光ビームスプリッタ3 05により、直交する直線偏光である測定光と参照光とに分割される。測定光と参照光は それぞれ、1/4波長板308、1/4波長板306により直線偏光から円偏光に変換さ れた後、治具321に固定された測定対象物501及び参照面307で反射する。反射し た測定光と参照光とは、それぞれ1/4波長板308、306により、入射時とは90度 振動方向が異なる互いに直交する直線偏光に変換された後、偏光ビームスプリッタ305 により合成される。合成された合成光は、1/4波長板310により、左回り円偏光、右 回り円偏光の合成光に変換される。

[0015]

またこの干渉計は、結像レンズ311と、ビームスプリッタ312、313及び反射プ リズム314からなる光分割部材とを備えている。この光分割部材により分割された3つ の分割光は、偏光板315、317、319を介して、CCDカメラ316、318、3 20にそれぞれ投影される。

[0016]

偏光板315、317、319は、透過軸方向が45度ずつ異なっており、これらを通 40 過した3つの分割光の位相を90度ずつ異ならせるようにするものである。

【 0 0 1 7 】

前記3つの分割光による干渉縞の各対応点同士でバイアス、振幅が等しければ、次のような演算手順により、測定対象物の形状を測定することができる。すなわち、3つの分割 光による干渉縞画像の画像信号の差を求め、その余弦信号S、正弦信号Cを得る。そして 、S/Cの逆正接arctan(S/C)を計算する。これにより、参照光と測定光の位 相差が特定され、これにより測定対象物の形状を測定することができる。この測定方法の 詳細な説明は特許文献1にもなされているので、ここでは省略する。

【0018】

しかし、干渉計を構成する光学部材の出荷当時からの各種誤差や、経時変化等による事 50

後的な誤差により、各干渉縞画像の対応点間でバイアス、振幅が等しくならない場合が生 じる。バイアス、振幅が等しくない場合、画像信号の差を演算してもバイアス成分が消去 されず、また逆正接の演算時に振幅成分が消去されない。また、各干渉縞画像間に相対的 に付与される位相シフト量においても、同様の理由により、設計値どおりの正確な量を与 えられるものではない。そのため、上記の演算手順では高精度に参照光と測定光の位相差 を特定することができない。

【0019】

そこで、本実施の形態の干渉計では、次の方法により、各CCDカメラ316、318 、320の干渉縞の干渉縞強度のバイアス、振幅、及び位相シフト量を測定し、干渉計の 校正を実行する。まず、治具321に測定対象物501に代えて、校正用基板502を固 定する。校正用基板502は、干渉縞強度のバイアス、振幅、及び位相シフト量を測定す る限りにおいては、形状が既知のものである必要はない。 【0020】

10

ただし、形状既知の校正用基板502を用い、干渉縞を解析して校正用基板502の形 状を算出し、その算出値と校正用基板502の形状の真値との差を算出することにより、 干渉計で系統的に発生する系統誤差を把握することができる。把握された系統誤差に基づ いて測定対象物Wの測定結果を補正することが可能になる。

【0021】

そしてこの校正用基板502に、波長可変レーザ301の出射光を、その波長を複数通 りに変化させて照射し、その異なる波長毎に各CCDカメラ316、318、320で干 ²⁰ 渉縞画像を撮影する。

【0022】

 一般的に、1つのCCDカメラ316、318又は320により得られる干渉縞の干渉 縞強度I_i(i=1、2、3。i=1はCCDカメラ316を、i=2はCCDカメラ3 18を、i=3はCCDカメラ320をそれぞれ表している)は、次の[数1]により表 現することができる。

【0023】

【数1】

$$I_i(x, y, \lambda) = B_i(x, y) + A_i(x, y) \cos(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta L(x, y) + \delta \phi_i(x, y))$$

2

ただし、
$$\Delta L(x, y) = L2(x, y) - L1(x, y)$$

【0024】

ここで、B_i(x、y)はバイアス、A_i(x、y)は振幅を示しており、(x、y) は、各対応点の座標を示している。また、 L(x、y)は、偏光ビームスプリッタ30 5により分割され、再び合成されるまでの参照光の光路長L1(x、y)と、測定光の光 路長L2(x、y)の差である。また、 _i(x、y)は、干渉縞強度I₁、I₂、I 3の位相であり、偏光板315、317、319により90°刻みで異なる値を与えられ ている。

【0025】

波長可変レーザ310の出射光の波長 を波長シフト量 だけ変化させた場合、この 40 干渉編強度I_iは、次の[数2]により表される。

【0026】

【数2】

$$I_{i}(x, y, \lambda + \Delta \lambda) = B_{i}(x, y) + A_{i}(x, y)\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda + \Delta \lambda} \cdot \Delta L(x, y) + \delta \phi_{i}(x, y)\right)$$
$$\approx B_{i}(x, y) + A_{i}(x, y)\cos\left[\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta L(x, y) \cdot (1 - \frac{\Delta \lambda}{\lambda}) + \delta \phi_{i}(x, y)\right)\right]$$

【0027】

この[数2]は、更に次のように変形して表現することができる。

50

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 8 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} \chi & 3 & 3 \end{bmatrix}$ $I_i(x, y, \lambda + \Delta \lambda) \approx B_i(x, y) + A_i(x, y) \cos(F_i(x, y) + G\Delta \lambda)$ $F_i(x, y) = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta L(x, y) + \delta \phi_i(x, y),$ $G = -\frac{2\pi}{\lambda^2} \cdot \Delta L$

[0029]

すなわち、波長を から波長シフト量 だけ異ならせた場合においてCCDカメラ3 16、318、又は320のそれぞれで撮像される異なる干渉縞画像は、[数3]に示す ように、G・ (G=-2 / ²)だけ位相が異なる波形として表現することができ る。

[0030]

従って、この波長シフト量 を、例えば少なくとも3通りに変化させて、その異なる 少なくとも3通りの波長シフト量 の場合に関し、1つのCCDカメラ316、318 、又は320で異なる干渉縞を撮像し、その干渉縞強度を取得することにより、バイアス B_i(x、y)、振幅A_i(x、y)、及び位相F_i(x、y)を計算することができる 。計算された位相F_i(x、y)から、各分割光の位相シフト量 _i(x、y)も計算 することができる。こうして計算されたバイアスB_i(x、y)等の値は記憶部403に 記憶され、後述するように、測定対象物501の形状測定において、形状を高精度に算出 するために用いられる。

【0031】

N通り(N 3)の波長は、互いに異なる値を有するものであればその大きさ及び間隔 は不問であるが、一例として、[数4]のように、N通りの波長シフト量 _jを、1周 期(2)をN等分した値に設定することができる。

【0032】

【数4】

$$G \cdot \Delta \lambda_j = \frac{2\pi}{N} \cdot j$$

この条件の下、以下の [数 5] の計算を行うことにより、バイアス B _i (x 、 y) 、振 幅 A _i (x 、 y) 及び位相 F _i (x 、 y) が算出される。

【0034】

【数5】

$$B_{i}(x, y) = 1/N \cdot \sum_{j=1}^{N} I_{ij}(x, y)$$

$$A_{i}(x, y) = 2/N \cdot \left\{ \left[\sum_{j=1}^{N} I_{ij}(x, y) \cdot \cos(G \cdot \Delta \lambda_{j}) \right]^{2} + \left[\sum_{j=1}^{N} I_{ij}(x, y) \cdot \sin(G \cdot \Delta \lambda_{j}) \right]^{2} \right\}^{1/2}$$

$$F_{i}(x, y) = \tan^{-1} \left[\frac{-\sum_{j=1}^{N} I_{ij}(x, y) \cdot \sin(G \cdot \Delta \lambda_{j})}{\sum_{j=1}^{N} I_{ij}(x, y) \cdot \cos(G \cdot \Delta \lambda_{j})} \right]$$

$$\left[0 \ 0 \ 3 \ 5 \right]$$

F_i(x、y)から、位相 _i(x、y)も算出することができる。なお、この実施 の形態では、 _i(x、y)を算出する代わりに、CCDカメラ316(i=1)によ 50

30

40

10

り撮像された干渉縞の干渉縞強度の位相を基準位相とし、次の[数6]で表現される、基 準位相に対する相対的位相シフト量 (x、y)、 (x、y)を演算し記憶する。参照 面に対する測定対象物の相対形状を測定する場合には、この相対的位相シフト量 (x、 y)、 (x、y)から演算する方が、以降の説明から明らかなように演算を簡便にする ことができる。

[0036]【数6】

 $\alpha(x, y) = F_2(x, y) - F_1(x, y)$

 $\beta(x, y) = F_3(x, y) - F_1(x, y)$

[0037]

10

20

30

次に、こうして校正用基板502を測定して得られたバイアスB;(×、y)、振幅A ;(×、y)、及び位相シフト量 (×、y)、 (×、y)を用いて補正を行い、測定 対象物501の測定を高精度化する方法について説明する。

[0038]

まず、測定対象物501、又は校正用基板502を測定した場合において生じる各種の 光の強度を図2、3に示すように定義する。参照面307で反射する参照光の強度をa(x、 y)、ビームスプリッタ312、ビームスプリッタ313、反射プリズム314でそ れぞれ反射する参照光の強度をa╷(x、y)、aっ(x、y)、a₃(x、y)と定義 する。これらは、測定対象物501を測定する場合と、校正用基板502を測定する場合 とで同一である。

[0039]

また、校正用基板502を測定する場合において校正用基板502で反射する測定光の 強度を b (x 、 v) 、ビームスプリッタ 3 1 2 、ビームスプリッタ 3 1 3 、反射プリズム 314 でそれぞれ反射する測定光の強度をb₁(x、y)、b₂(x、y)、b₃(x、 y)と定義する。 a , (x 、 y)、 b , (x 、 y)は、バイアス B , (x 、 y)、振幅 A i (x、y)と、次の [数7] に示すような関係にある。

[0040]

$$B_i(x, y) = a_i(x, y) + b_i(x, y)$$

 $A_i(x, y) = 2\sqrt{a_i(x, y) \cdot b_i(x, y)}$

[0041]

校

正用基

板

502の

測定により

バイアス

B

、

(

x

、

y

)、

振幅

A

、

(

x

、

y

)の

値

が

得
 られているので、この[数7]の2式から、ai(x、y)、bi(x、y)も特定する ことができる。

[0042]

また、測定対象物501を測定する場合において測定対象物501で反射する測定光の 強度を b ' (x、 y)、ビームスプリッタ 3 1 2、ビームスプリッタ 3 1 3、反射プリズ ム 3 1 4 でそれぞれ反射する測定光の強度を b 1 ' (x 、 y) 、 b 🤈 ' (x 、 y) 、 b 🦡 40 '(x 、 y)と定義する。この測定光 b '(x 、 y)の測定光 b (x 、 y)に対する強度 比を反射率比 (×、y)として下記の[数8]のように定義する。

[0043] 【数8】

$$b'(x, y) = r(x, y)b(x, y)$$

[0044]

また、光分割後の測定光の強度 b 1 ' (×、y)についても、同様に下記 [数9]に示 す関係が成り立つ。

【0045】

50

【数9】 $b'_{1}(x, y) = r(x, y)b_{1}(x, y)$ $b'_{2}(x, y) = r(x, y)b_{2}(x, y)$ $b'_{3}(x, y) = r(x, y)b_{3}(x, y)$ [0046]測定対象物 5 0 1 を測定する場合のバイアス B ; ' (x 、 y) 、振幅 A ; ' (x 、 y) は、上記 b, (x、y)と反射率比 (x、y)を用いて、次の [数10]のように表さ れる。 [0047] 10 【数10】 $B_{i}'(x, y) = a_{i}(x, y) + r(x, y)b_{i}(x, y)$ $A_i'(x, y) = 2\sqrt{a_i(x, y) \cdot r(x, y) \cdot b_i(x, y)}$ $=\sqrt{r(x,y)} \cdot A_i(x,y)$ [0048]このため、測定対象物501を測定する場合に各CCDカメラ316,318,320 で得られる干渉縞の強度 I, (x、y)は、次の [数11]で表される。 [0049]【数11】 20 $I_1'(x, y) = a_1(x, y) + r(x, y)b_1(x, y) + 2\sqrt{a_1(x, y)} \cdot r(x, y) \cdot b_1(x, y) \cos[\phi(x, y)]$ $I_{2}'(x, y) = a_{2}(x, y) + r(x, y)b_{2}(x, y) + 2\sqrt{a_{2}(x, y) \cdot r(x, y) \cdot b_{2}(x, y)} \cos[\phi(x, y) + \alpha(x, y)]$ $I_{3}'(x, y) = a_{3}(x, y) + r(x, y)b_{3}(x, y) + 2\sqrt{a_{3}(x, y) \cdot r(x, y) \cdot b_{3}(x, y)} \cos[\phi(x, y) + \beta(x, y)]$ [0050] I_i'(x、y)をCCDカメラ316,318、320の画像信号から取得し、この Ⅰ,'(x、y)を用いて、 (x、y)を、例えば次のようにして代数的に求めること ができる。 [0051]まず、上記 [数 1 1] を変形して、 I _i ' (x 、 y) - a _i (x 、 y) を左辺とした下 30 記[数12]とする。 [0052] 【数12】 $I_1'-a_1 = \gamma b_1 + 2A_1 \sqrt{\gamma} \cos \phi$ $I_2'-a_2 = rb_2 - 2A_2\sin\alpha \cdot \sqrt{\gamma} \cdot \sin\phi + 2A_2\cos\alpha \cdot \sqrt{\gamma}\cos\phi$ $I_3' - a_3 = rb_3 - 2A_3 \sin\beta \cdot \sqrt{\gamma} \cdot \sin\phi + 2A_3 \cos\beta \cdot \sqrt{\gamma} \cos\phi$ [0053] $(x, y), ((x, y))^{1/2} \cdot sin, ((x, y))^{1/2} \cdot cos$ 40 についてこの [数12]を解く。 [0054] 【数13】 $\begin{bmatrix} \gamma \\ \sqrt{\gamma} \sin \phi \\ \sqrt{\gamma} \cos \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 & 0 & A_1 \\ b_2 & -A_2 \sin \alpha & A_2 \cos \alpha \\ b_3 & -A_3 \sin \beta & A_3 \cos \beta \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} I_1' - a_1 \\ I_2' - a_2 \\ I_3' - a_3 \end{bmatrix}$ [0055]下記の[数14]に示す行列式が0にならない 、 であれば、[数13]を (×、 y), $((x, y))^{1/2} \cdot \sin ((x, y))^{1/2} \cdot \cos i \pi$

解くことができる。

(8)

[0056] 【数14】 $\begin{bmatrix} b_1 & 0 \end{bmatrix}$ A. det $b_2 - A_2 \sin \alpha A_2 \cos \alpha$ $b_3 - A_3 \sin \beta A_3 \cos \beta$ [0057]((x、y))^{1 / 2}・sin 、((x、y))^{1 / 2}・cos が得られたら 、両者の比の逆正接を、下記[数15]のようにとることにより、 を求めることができ る。 [0058] 10 【数15】 $\phi = \tan^{-1} \left\{ \frac{\sqrt{r} \sin \phi}{\sqrt{r} \sin \phi} \right\}$ Vr cos d $=\tan^{-1}\left\{\frac{[b_2A_3\cos\beta-A_2\cos\alpha+b_3](I_1'-a_1)+[-b_2A_3\cos\beta-A_1b_3](I_2'-a_2)+[b_1A_2\cos\alpha-A_1b_2](I_3'-a_3)}{[a_1-a_2](I_3'-a_3)}\right\}$ $b_2A_3\sin\beta - A_2\sin\alpha \cdot b_3(I_1'-a_1) - b_1A_3\sin\beta - A_1b_3(I_2'-a_2) + b_1A_2\sin\alpha \cdot (I_3'-a_3)$ [0059] この [数15]は反射率比の大きさに無関係に恒等的に成立するため、1、すな わち、校正用基板502として、測定対象物501と反射率が異なるものを用いても、そ の影響を受けることなく測定値の校正を行うことができる。また、 の数値を求めること 20 なく、測定値の校正を行うことができる。ちなみに、反射率比 (×、y)は次の式から 求めることが可能である。 [0060]【数16】 $\gamma = \frac{A_2 A_3 [\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta] (I_1' - a_1) + A_1 A_3 \sin \beta (I_2' - a_2) - A_1 A_2 \sin \alpha (I_3' - a_3)}{A_1 A_2 \sin \alpha (I_3' - a_3)}$ $b_1 A_2 A_3 \sin \alpha \cos \beta - b_1 A_2 A_3 \cos \alpha \sin \beta + b_2 A_1 A_3 \sin \beta - b_3 A_1 A_2 \sin \alpha$ [0061]図4は、本発明の第2の実施の形態に係る干渉計の全体構成を示している。この実施の 形態の干渉計は、図4に示すように、ビームスプリッタ312、313、及び反射プリズ ム314により3分割した測定光及び参照光による干渉縞画像を、1つのCCDカメラ3 22により撮像するように干渉計を構成するものである。 30 [0062]図5は、本発明の第3の実施の形態に係る干渉計の構成のうち、レンズ311以降の部 分のみを示している。その他の部分は上記の実施の形態と同一であるので、詳細な説明は 省略する。この実施の形態の干渉計は、ビームスプリッタ312、313、及び反射プリ ズム314に代えて回折格子323により測定光及び参照光を分割し、偏光板315,3 17、319、324で位相差を与える形式を採用している。撮像素子は、図5のような 1つのCCDカメラ325でも良いし、図1のような分割光毎に設けられたCCDカメラ であっても良い。 [0063]図6は、本発明の第4の実施の形態に係る干渉計の全体構成を示している。この実施の 40 形態の干渉計は、図6に示すように、高密度位相アレイ素子460により測定光及び参照 光を複数に分割し、その分割された光に位相差を与える形式を採用している。この高密度 位相アレイ素子460は、本願の出願人が出願した特開2004-138617号公報に 開示のものと同一であり、以下にその構成を簡単に説明する。高密度位相アレイ素子46 0は、低次数のクォーツ波長板などの複屈折基板462を備えている。複屈折基板462 は、表面469および速軸468を有する。遅軸は、この速軸468と直交する方向を向 いている。

[0064]

複屈折基板462は、対応する画素群毎に例えば矩形状に形成されたパターン461(
 部分466a~d)の厚さが4通り(T₀、T₉₀、T₁₈₀、T₂₇₀)に異なるよう

に形成され、これにより、4つの異なる相対位相変位(P₀、P₉₀、P₁₈₀、P₂₇ ₀)を有する干渉縞画像を生成するものである。なお、複屈折基板461は、厚さ依存性 の位相を与えない平面層462により覆われている。

【0065】

この構造においても、各光学素子を誤差無く製作し配置することは極めて困難であり、 複数の干渉縞画像管のバイアス、振幅のバラツキや位相シフト量の設計値に対する偏差が 発生することが予想される。そのため、上記のような校正法が、この第4の実施の形態に おいても適用され得る。

[0066]

次に、本発明の第5の実施の形態を、図8を参照して説明する。上記の第1乃至第4の ¹⁰ 実施の形態は、測定対象物501が、その裏面からの反射が無いか、或いは無視できるも の(例えば、測定対象物501が(1)金属鏡面、(2)表面と裏面との間に相対的に傾 斜加工を施したウェッジ型のガラス基板、(3)裏面が粗面加工されたガラス基板、など である)である場合に、適用可能である。裏面からの反射が無視できない場合、その反射 光はノイズ光となり、干渉縞のバイアス、振幅、位相シフト量等の正確な測定が困難又は 不可能になる。

【0067】

これに対しこの第5の実施の形態の干渉計及びその校正方法は、測定対象物の裏面から の反射光(ノイズ光)が無視できない測定対象物に対しても干渉縞信号のバイアス、振幅 等の測定が可能に構成されている点で、上記の実施の形態と異なっている。

【0068】

図8は、本実施の形態に係る干渉計の構成例を示している。ここで、測定対象物に対応 する校正用基板502Aが干渉計に設置され、測定対象面である表面502Sからの測定 光だけでなく、裏面502Rからのノイズ光が無視できないものと考える。なお、この図 8に示す干渉計は、光学系の構造自体は第1の実施の形態(図1)と同様である。また、 波長可変コントローラ402により波長可変レーザ301の波長が可変とされている点も 同様である。

【0069】

[0070]

そして、各CCDカメラ316、318、320の各々において、その波長の変動によ 40 る光を積分受光する。ここで積分受光とは、CCDカメラの露光時間Te内に波長 をあ る波長幅に亘り変化させて受光することを意味する。これにより、裏面502Rからのノ イズ光の影響を受けることなく、干渉縞のバイアス、振幅及び位相シフト量を測定するこ とができる。以下、この積分受光の原理を詳しく説明する。

【0071】

裏面502Rからのノイズ光が無視できない場合、参照光、測定光、及びノイズ光の合成光の、1つのCCDカメラ316、318、又は320のいずれかで得られる干渉縞強度Ii[´]は、次の式で表される。なお、参照光、測定光及びノイズ光を複素振幅で表した場合の振幅を1とし、簡略化して示している。また、干渉縞画像は2次元の光強度分布を有するが、次の式以降では、ある1点の光強度を1次元で簡略化して示している。

(11)

【0072】 【数17】 $I_i' = \operatorname{Re}\left[\left\{\exp(ikL_1) + \exp(ikL_2) + \exp(ikL_3)\right\} \cdot \left\{\exp(ikL_1) + \exp(ikL_2) + \exp(ikL_3)\right\}^*\right]$ = $\operatorname{Re}\left[3 + 2\exp\{ik(L_2 - L_1)\} + 2\exp\{ik(L_3 - L_2)\} + 2\exp\{ik(L_3 - L_1)\}\right]$ ここで、L₁、L₂、L₃は、それぞれ参照光、測定光、対象物の裏面からの反射光の 光路長を表す。また、kは波数(=2 /)を表している。 L₂とL₁の差、L₃とL₁の差をそれぞれ L₂₁、L₃₁とすると、[数17] は次式のように表現することができる。 【0073】

10

20

【数18】

 $I_{i}' = 3 + 2\cos(k\Delta L_{21}) + 2\cos\{k(\Delta L_{31} - \Delta L_{21})\} + 2\cos(k\Delta L_{31})$ = 3 + 2\cos(k\Delta L_{21}) + 2\cos(k\Delta L_{31}) + 2\cos(k\Delta L_{21})\cos(k\Delta L_{31}) + 2\sin(k\Delta L_{21})\sin(k\Delta L_{31})

CCDカメラの露光時間Te内において中心波長 を中心として波長走査幅 pで波長 を変化させた場合に、各波長により発生する干渉縞画像の積分強度としての積分干渉縞強 度I_iが得られる。積分干渉縞強度I_iは、次の式で表される。

【0074】

【数19】

 $I_i = \int_{-\Delta p/2}^{\Delta p/2} I_i' dp$

 $= \int_{k=1/2}^{k_{2}/2} [3 + 2\cos(k\Delta L_{21}) + 2\cos(k\Delta L_{31}) + 2\cos(k\Delta L_{21})\cos(k\Delta L_{31}) + 2\sin(k\Delta L_{21})\sin(k\Delta L_{31})]dp$

なお、波長走査幅 pは、次の式で表される範囲で設定されるのが好適である。

【0075】

 $\begin{bmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{2} & \mathbf{0} \end{bmatrix}$ $\frac{\lambda^2}{\Delta L_{31}} < \Delta p < \frac{\lambda^2}{\Delta L_{21}}$

波長走査幅 pは、可干渉距離 1と関連がある。上記[数20]を満たすように p が設定されることにより、可干渉距離 1よりも光路差 L₃₁を大きくし、かつ可干渉 距離 1よりも光路差 L₂₁を小さくすることができる。これにより、裏面502Rからの反射光であるノイズ光の影響は低減又は除去される一方、表面502Sからの反射光 (測定光)は、消えることなく干渉縞画像を得ることができる。

ここで、参照光の光路長 L₁と測定光の光路長 L₂が略等しくなるように測定対象物W の位置調整がなされていると考える。この場合、 [数 1 9]の各項のうち、第 2 項のよう に L_{2 1}のみを含む項は、波長に関係なく略一定の強度となり、測定対象物Wの形状に よって変化する強度となる。

【0077】

一方、第3項のように L₃₁のみを含む項は、波長が走査されることで強度が変動す るが、積分されると平均強度となり、 L₃₁とは無関係の強度となる。従ってこの第3 項は、干渉縞強度Iにおいて、バイアスを表す項となる。第1項の定数項も、バイアスを 表す項となる。第4項、第5項は、測定対象物Wの形状に応じて変化する強度にバイアス 成分が積算された強度となる。従って、[数19]は、次式のように簡略化して表現する ことができる。

[0078] [数21] $I_i ≈ B_i + A_i \cos(k\Delta L_{21})$ 30

ただし、 B_iはバイアス、 A_iは振幅を表している。従って、裏面反射のノイズ光が存 在する場合であっても、中心波長 を中心として波長走査幅 pに亘って波長走査を行う ことにより、積分された干渉縞画像が得られ、裏面反射の影響を除いて計測を行うことが できる。

【0079】

さらに、このような計測を、3通り以上の中心波長 0、 0 + 1、・・・ 0 + j各々において実行し、CCDカメラ316、318、320で干渉縞を撮像して実 行することにより、測定対象物501の裏面からのノイズ光による影響を低減させつつ、 干渉縞のバイアス、振幅及び位相シフト量を測定することができる。このバイアス、振幅 10 及び位相シフト量の測定の方法を、以下において詳細に説明する。 【0080】

各CCDカメラ316、318及び320で得られる積分干渉 編強度 I_{ij}は、位相シ フト量 _iの違いを考慮して、

【0081】

【数22】

$$I_{ij} \approx B_i + A_i \cos(\frac{2\pi}{\lambda_i} \Delta L_{21} + \delta \phi_i)$$

と表される。波長 _jを ₀から _jだけ変化させた場合において、 ₀に比べ _jが十分小さい場合には、次式で近似できる。 【 0 0 8 2 】

【数23】

$$I_{ij} \approx B_i + A_i \cos(\frac{2\pi}{\lambda_0 + \Delta\lambda_j} \Delta L_{21} + \delta\phi_i)$$
$$\approx B_i + A_i \cos(\frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta L_{21} (1 - \frac{\Delta\lambda_j}{\lambda_0}) + \delta\phi_i)$$

20

30

この式は、更に次のように変形することができる。 【 0 0 8 3 】 【 数 2 4 】 $I_{ij} \approx B_i + A_i \cos(F_i + G\Delta\lambda_j)$ ただし $F_i = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta L_{21} + \delta\phi_i$ $G = \frac{2\pi}{{\lambda_0}^2} \Delta L_{21}$

40

50

【0084】

すなわち、中心波長 を ₀、 ₀ + ₁、・・・、 ₀ + _jとシフトさせた場 合に1つのCCDカメラ316、318又は320で得られる積分干渉強度I_i」は、位 相がG _jだけ位相が異なる波形として表現することができる。従って、波長シフト量 _jを少なくとも3通りに変化させ、その異なる少なくとも3通りの波長シフト量それ ぞれについて、3つのCCDカメラ316、318及び320で撮像を行い、上記の実施 の形態と同様に、バイアスB_i、振幅A_i、及び位相シフト量 _i等を演算することが

(12)

できる。また、第1の実施の形態で説明した「数4]のように位相シフト量を演算し、「 数5]のようにしてバイアスB,、振幅A,、及び位相シフト量 ,等を演算すること もできる。

(13)

ー例として、1つの中心波長を ₀=1µmとし、厚さ4mmで屈折率1.5程度のガ ラス基板を測定対象物及び校正用基板とする場合、 p=0.1nm、 1=0.2n mとなるように波長をコントロールすればよく、市販の波長可変レーザで容易に実施可能 である。

[0085]

以上干渉計の校正方法の実施例は、測定対象に代えて校正用基板を設置することで示し た。複数の対象物を測定する場合に、校正用基板を設置して校正する変わりに、そのうち の1つまたはいくつかを使って、干渉計の校正を行っても良い。また、干渉計の観測領域 よりも大きな対象物の形状を走査測定する場合には、対象物の一部の領域を使って校正を 行い、そのときに得られた校正値を使って、他の領域を走査測定しても良い。いずれの場 合にも、校正用基板を別途用いなくても良いこと以外は、解決すべき課題と手法はまった く同じである。

以上、発明の実施の形態を説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、発 明の趣旨を逸脱しない範囲内において、種々の変更、追加等が可能である。

【図面の簡単な説明】

[0086]

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る干渉計の構成を示している。

【図2】図1の干渉計において、校正用基板502を測定した場合において生じる各種の 光の強度を定義するものである。

【図3】図1の干渉計において、測定対象物501を測定した場合において生じる各種の 光の強度を定義するものである。

【図4】本発明の第2の実施の形態に係る干渉計の構成を示している。

【図5】本発明の第3の実施の形態に係る干渉計の構成を示している。

【図6】本発明の第4の実施の形態に係る干渉計の構成を示している。

【図7】図6の高密度位相アレイ素子460の構造を示す。

【図8】本発明の第5の実施の形態に係る干渉計の構成を示している。

【図9】第5の実施の形態の波長可変レーザ301から出射される波長の範囲を示すグラ フである。

【符号の説明】

[0087]

301・・・波長可変レーザ、 302・・・集光レンズ、 303・・・ピンホール 304・・・コリメータレンズ、 305・・・偏光ビームスプリッタ、 306、 308、310・・・1/4波長板、 307・・・参照面、 311・・・結像レンズ 312、313・・・ビームスプリッタ、 314・・・反射プリズム、 315、 317、319、324・・・偏光板、 316、318、320、322、325・・ ・CCDカメラ、 321・・・治具、 323・・・回折格子、501・・・測定対象 40 物、 401・・・コンピュータ、 402・・・波長コントローラ、 403・・・記 501・・・測定対象物、 502・・・校正用基板。 憶部、

20





【図3】







【図6】





【図7】

【図8】









フロントページの続き

(72)発明者 デイビッド ダブリュー セスコ アメリカ合衆国 ワシントン州ウッディンヴィル206番 アベニュー エヌ・イー 15123

合議体

 審判長
 飯野
 茂

 審判官
 中塚
 直樹

 審判官
 関根
 洋之

(56)参考文献 特開2002-13907(JP,A) 特開2000-275021(JP,A) 特開2004-37165(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名) G01B 9/02 G01B 11/00-11/30